

رشد و بررسی خواص نوری نانو ساختارهای خالص اکسید روی و آلاییده شده با نقره

به روش سل-ژل

سارا خسروی گندمانی^۱، رامین یوسفی^{۲*} و فرید جمالی شینی^۳

^۱دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فیزیک، فارس، ایران

^۲دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجدسلیمان، گروه فیزیک، مسجدسلیمان، ایران

^۳دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هواز، گروه فیزیک، هواز، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۱/۰۳/۱۸

تاریخ تصحیح: ۹۱/۰۲/۳۰

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۱/۱۹

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های ۲٪، ۴٪ و ۶٪ با نقره به وسیله روش سل-ژل در محیطی ژلاتینی تهیه شدند. در این فرآیند، ژلاتین به عنوان یک عامل پلیمریزاسیون مورد استفاده قرار گرفت. از نیترات روی و نیترات نقره به عنوان مواد اولیه و اکتش استفاده شد. پس از تهیه نانوذرات خالص و آلاییده با نقره، ساختار و ماهیت آنها با استفاده از آنالیز پراش پرتو X بررسی شد و ریخت‌شناسی نمونه‌ها بوسیله TEM مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص نوری نمونه‌ها با به کار گیری طیف سنجی‌های UV-Visible و فتو لومینیسانس (PL) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج XRD ساختار شش گوش (اورتوسایت) محصولات و وارد شدن یون‌های نقره در میان شبکه ZnO را نشان می‌دهد. همچنین، نتایج PL و UV-Visible نشان دادند که خواص نوری نانوذرات اکسیدروی خالص بهتر از نمونه‌هایی است که تحت تاثیر آلایش نقره قرار گرفتند. علاوه بر این نتایج مطالعات نوری نشان داد که گاف انرژی نانوذرات اکسید روی بواسطه وجود نقره افزایش یافته است.

واژگان کلیدی: نانوذرات، اکسیدروی، سل-ژل، آلایش نقره، خواص نوری

۱- مقدمه:

اکسید روی نیمرسانایی با گاف نواری بسیار بزرگ (۳/۳۷ الکترون ولت) در دمای اتفاق است. چنین گاف نواری بزرگی باعث می‌شود که نانوساختارهای اکسید روی بهترین کاندیدا برای ساخت ادوات نوری در محدوده فرابینش باشند. اکسید روی ذاتاً یک نیمرسانا از نوع n می‌باشد. این ویژگی اکسید روی، کاربرد آن را به عنوان یک نیمرسانا محدود می‌کند در نتیجه به دست آوردن نوع p این ماده و اتصال آن به نوع n می‌تواند منجر به ساخت وسایل الکترونیکی در ابعاد نانو شود. معمولاً از عناصر گروه اول و پنجم جدول تناوبی به عنوان ناخالصی‌های پذیرنده در ساخت نوع p نانو ساختارهای اکسید روی استفاده می‌شود. اخیراً یوسفی و همکارانش با استفاده از روش سل-ژل، نانوذرات اکسیدروی را با عناصر گروه اول آلاییده اند [۱]. اما نقره از گروه عناصر بواسطه نیز قادر است به عنوان ناخالصی پذیرنده در ساختار اکسید روی به کار رود و اکسید روی را به نوع p تبدیل کند. همچنین اخیراً رنجان و همکارانش با استفاده از روش احتراق به کمک امواج میکروویو پایداری نقص‌های ذاتی را در دمای ای بالا در نانوذرات اکسیدروی به وسیله تغییر شکل بلوری Ag مورد بررسی قرار دادند [۲]. هی و همکاران با استفاده از یک روش آزمایشگاهی، انتقال قطبشی و خاصیت مغناطیسی اکسیدروی آلاییده شده با نقره را مورد بررسی قرار دادند [۳]. شعبی عباس زیادی و همکاران با استفاده از یک روش هیدرоторمال آسان در دمای پایین، رشد و ویژگی‌های نانوگل‌های اکسیدروی آلاییده با

نقره را برای کاربرد سنسور شیمیابی فنیل هیدرازین با حساسیت بسیار بالا مورد بررسی قرار دادند [۴]. علاوه بر این، چاوهان و همکارانش با استفاده از روش شیمیابی هم رسوبی یک مطالعه‌ی فوتولکاتالیستی بر روی ترکیب شدن نانوذرات اکسیدروی آلاییده شده با نقره پرداختند [۵]. ان گویان و همکاران به آمده سازی و توصیف نانوساختارهای اکسیدروی آلاییده شده با نقره پرداختند. در این کار نانوذرات نقره بر روی سطح نانومیله‌های اکسیدروی (که به روش هیدروترمال ساخته شد) با استفاده از یک ساده سازی فوتولکاتالیستی تحت پرتوافکنی UV ته نشین شد [۶].

با تمامی مطالعات ذکر شده، تاکنون اثرات آلاییده‌های مختلف نقره بر روی ساختار بلوری و نوری اکسیدروی انجام نشده است. در این کار روش سل-ژل به عنوان روشی ارزان و کارآمد که قادر است آلایش را با یکنواختی در نانو ساختارهای نیمرسانایی مانند اکسید روی ایجاد کند، مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت اثرات این آلایش بر خواص نوری نانو ساختارهای اکسیدروی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- روش تجربی:

۲-۱- مواد شیمیابی مورد استفاده:

نیترات روی شش آبه با جرم مولکولی $g\cdot mol^{-1}$ ۲۹۷/۴۷ و نیترات نقره با جرم مولکولی $g\cdot mol^{-1}$ ۱۶۹/۸۷ ساخت شرکت Merck، ژلاتین و آب م قطر برای تهیه نانوذرات مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند.

۲-۲- دستگاه‌ها:

کلیه مطالعات ریخت شناسی بروی نمونه با استفاده میکروسکوپ الکترونی عبوری (LEO-906E)، آزمون پراش پرتو ایکس با دستگاه Siemens D5000 با اشعه‌ای دارای طول موج ($\lambda=1/۵۴۰.۶ \text{ \AA}$) در محدوده $۲۰^{\circ}-۸۰^{\circ}$ ، آزمون نورتابناکی (PL) با دستگاه Perkin-Elmer Jobin Yvon Horiba HR 800 UV با طول موج تحریک nm ۳۲۰ و آنالیز UV-Vis با دستگاه Lambda-25 صورت گرفت.

۳-۱- روش تهیه نانوساختارهای اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان‌های مختلفی از نقره:

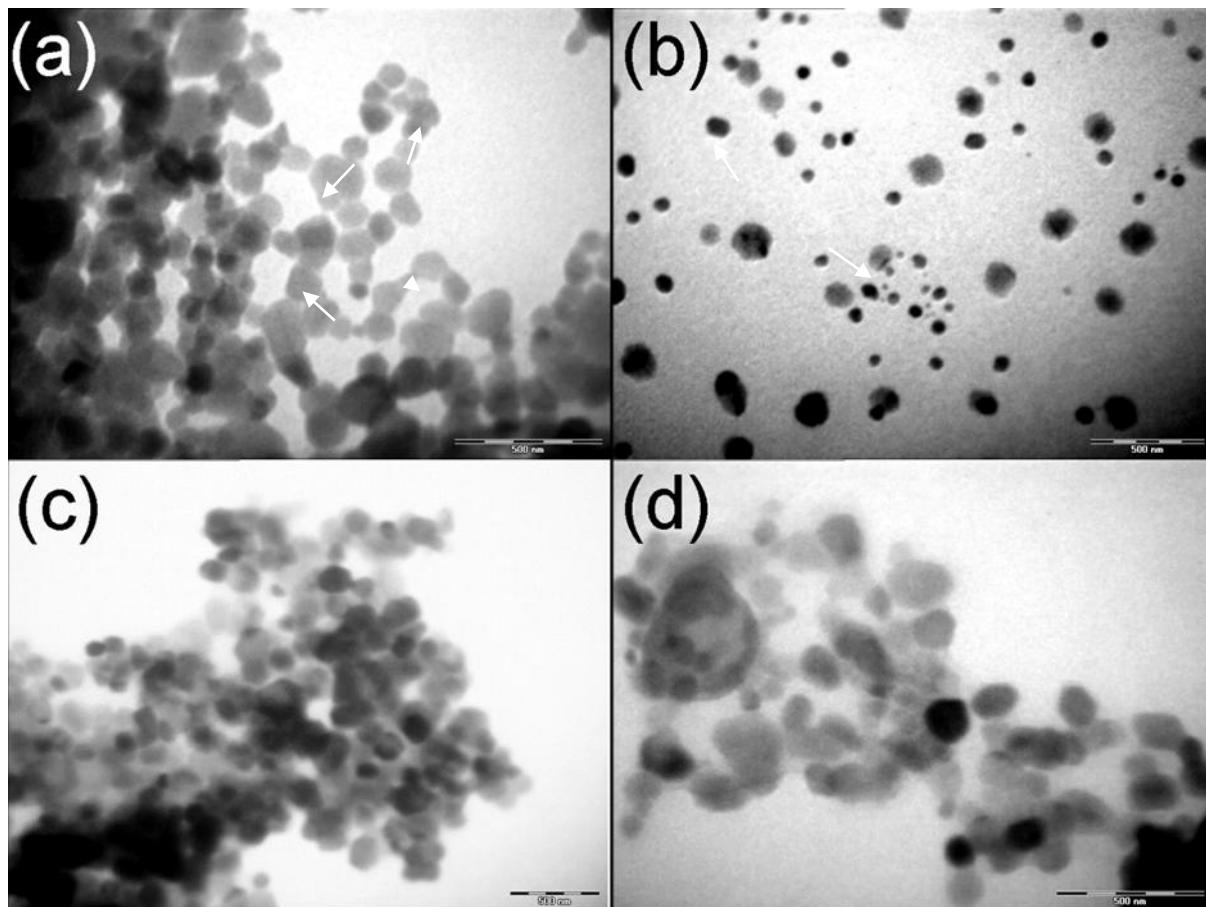
برای تهیه ۲ g نانوذرات ZnO ابتدا محلول ژلاتین در دمای 60°C تهیه شد. پس از آن به میزان لازم نیترات روی در مقدار کمی از آب م قطر حل و به محلول ژلاتین اضافه شد. سپس این دو محلول در دمای 80°C با هم ترکیب شده تا یک ژل عسل مانندی به دست آید. در نهایت ژل حاصله در دمای 550°C به مدت $5/5$ ساعت با نرخ $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ در کوره کلسینه شد. برای تهیه ۲ g نانوذرات ZnO:Ag با میزان‌های ناخالصی ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ Ag، با توجه به میزان ناخالصی مقدار ژلاتین و نیترات‌های فلزی اندازه گیری می‌شود، به این صورت که نیترات‌های فلزی جداگانه در مقدار کمی آب م قطر حل می‌شوند و به محلول ژلاتین اضافه می‌شوند. در ادامه نیز مانند آنچه که برای نمونه خالص گفته شد، عمل شد.

۳-۲- نتایج و بحث:

۳-۱- نتایج تصویر برداری توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری:

شکل ۱ نتایج حاصل از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) را برای نمونه‌های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان‌های مختلف ناخالصی نشان می‌دهد. با توجه به تصاویر TEM، بیشتر نمونه‌ها دارای اشکال کروی و یا شش گوش هستند. اندازه

میانگین ذرات اکسیدروی خالص در بازه بین $40 - 90\text{ nm}$ تخمین زده شد. افزایش غلظت نقره تاثیر کمی بر روی اندازه ذرات اکسیدروی می گذارد و با افزایش میزان ناخالصی اندازه ذرات نسبت به اکسیدروی خالص کاهش می یابد.



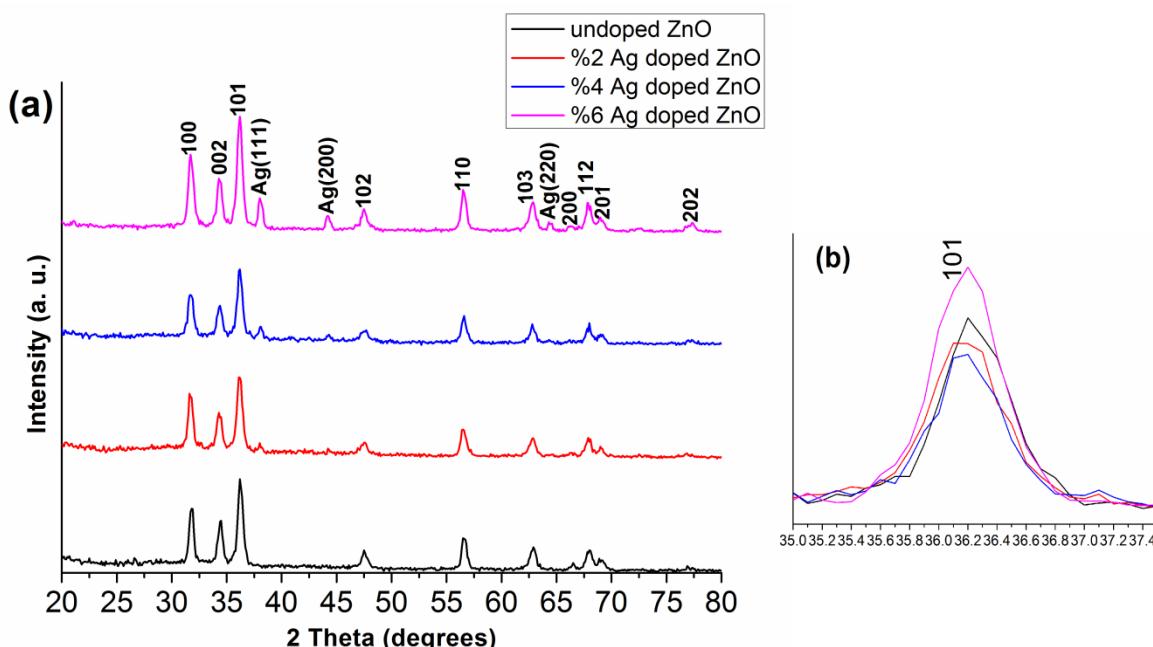
شکل ۱ . تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM): شکل (a) مربوط می شود به نانوذرات اکسیدروی خالص،(b) نانوذرات اکسیدروی آلاییده با ۲٪ از نقره، (c) نانوذرات آلاییده با ۴٪ از نقره، (d) نانوذرات آلاییده با ۶٪ از نقره

۲-۳- نتایج آنالیز پراش پرتو X

شکل ۲ الگوی پراش پرتو X را برای نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های مختلف از نقره (۰.۶٪ و ۰.۴٪) نشان می دهد. الگوهای XRD نشان می دهند که به جز ZnO و Ag هیچ فاز واکنشی دیگری وجود ندارد و همه نمونه ها بلوری بوده و فاز شش گوش هستند. الگوهای XRD نشان دادند که عناصر آلاییشی با قله های Ag در الگوهای پراش بر شکل گیری توده های نقره بلوری در نانوذرات تاکید دارد [۶]. هنگامی که عناصر آلاییشی با شعاع یونی بزرگ تر از Zn^{2+} در نقاط جانشینی شبکه بلوری اکسیدروی جایگزین می شوند، عموماً جابجا یی در قله های طیف XRD مشاهده می شود که این موضوع در شکل (۲(b)) نشان داده شده است. با توجه به اینکه یون Ag^+ اندازه یونی بزرگ تری ($1/22\text{\AA}$) نسبت به یون Zn^{2+} دارد ($0/74\text{\AA}$) دارد، پس جابجا یی در موقعیت قله های XRD اشاره به این دارد که تعدادی

از یون های Ag مکان هایی را درون شبکه اکسیدروی اشغال کرده اند. این امر از آنجا امکان پذیر است که Ag به عنوان یک آلاینده پذیرنده می تواند مکان های میان شبکه ای و جانشینی یون روی را اشغال کند. اندازه ریز بلورک ها برای نمونه ها با

استفاده از رابطه شر $D = \frac{0.94\lambda}{\beta \cos\theta}$ محاسبه شد. در این فرمول D اندازه دانه های بلورین، λ طول موج اشعه ایکس، β پهنه ای قله های بیشینه در نصف ارتفاع و θ زاویه های موقعیت قله های می باشد، بر این اساس اندازه بلورکها به ترتیب ۱۷/۷۴۲۶، ۱۷/۷۴۶۲، ۱۷/۷۴۴۰ و ۱۷/۷۴۳۱ nm برای اکسیدروی خالص، اکسیدروی آلاینده با میزان ناخالصی ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ از نقره محاسبه شد.

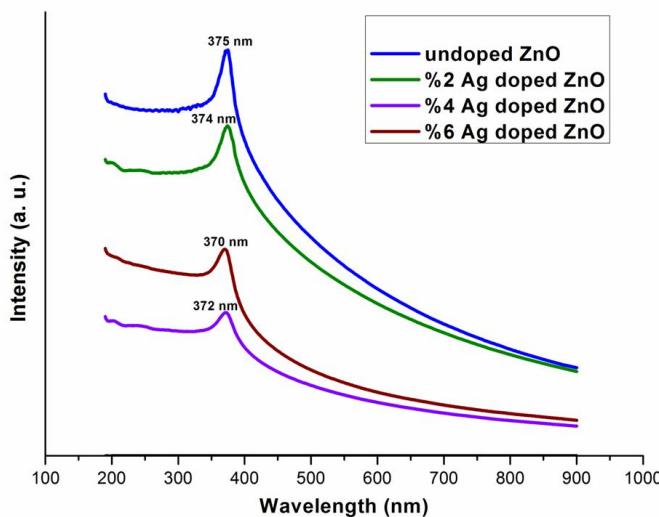


شکل ۲. (a) نتایج XRD برای نانوذرات اکسیدروی خالص و آلاینده با میزان های ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ از نقره، (b) جایه جایی در قله (101)

۳-۳-بررسی خواص نوری:

۳-۳-۱-نتایج UV-Visible

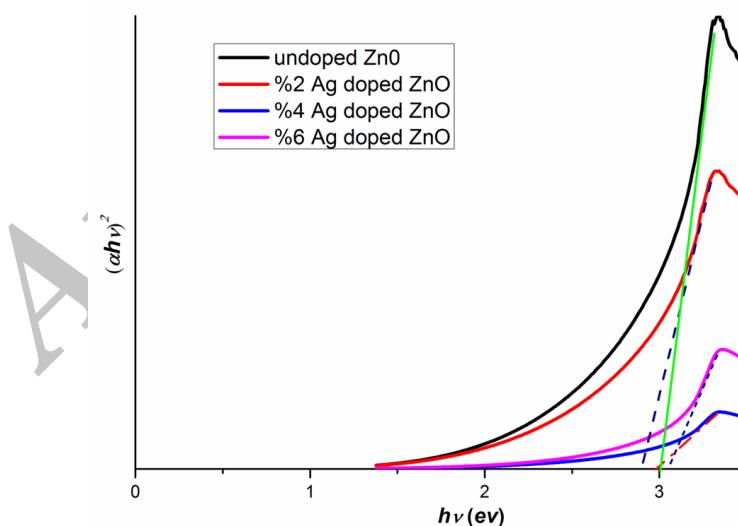
شکل ۳ نتایج حاصل از طیف سنجی UV-Visible نمونه های اکسیدروی خالص و آلاینده با میزان های مختلف از نقره را نشان می دهد. قله جذب تمامی نمونه های آلاینده نسبت به قله جذب نمونه خالص که در ۳۷۵ nm واقع شده است با افزایش میزان ناخالصی به سمت طول موج های کوتاه تر جایجا شده است که اصطلاحاً گفته می شود جایجا آبی دارد و می تواند دلیلی بر کوچکتر شدن اندازه ذرات باشد. این جایجا آبی در قله جذب نمونه های آلاینده را می توان با اثر بورشتین- ماس نیز توضیح داد. بر این اساس، با افزایش غلظت حامل ها در نمونه های آلاینده یافته با فلز واسطه، گذارهای کم انرژی کاهش می یابد و گاف نواری نمونه های آلاینده افزایش می یابد.



شکل ۳. نتایج UV-Visible نانوذرات اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ از نقره

۳-۳-۲- محاسبه گاف نواری نوری:

گاف نواری نوری نانوذرات را می توان با استفاده از رابطه تاک، $\alpha h\nu = B(h\nu - E_g)^n$ ، محاسبه کرد. برون یابی ناحیه خطی نمودار $(\alpha h\nu)^2$ در محور قائم و انرژی فوتون ($h\nu$) در محور افق، مقدار گاف نواری نوری (E_g) را به دست می دهد [۸، ۷]. این نمودار برای نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های مختلف از نقره در شکل ۴ ارائه شده است. گاف-نواری نوری نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ از نقره بدست آمده از رابطه Tauc به ترتیب ۳، ۲/۸۹ و ۲/۹۸ eV و ۳/۰۵ eV می باشد.

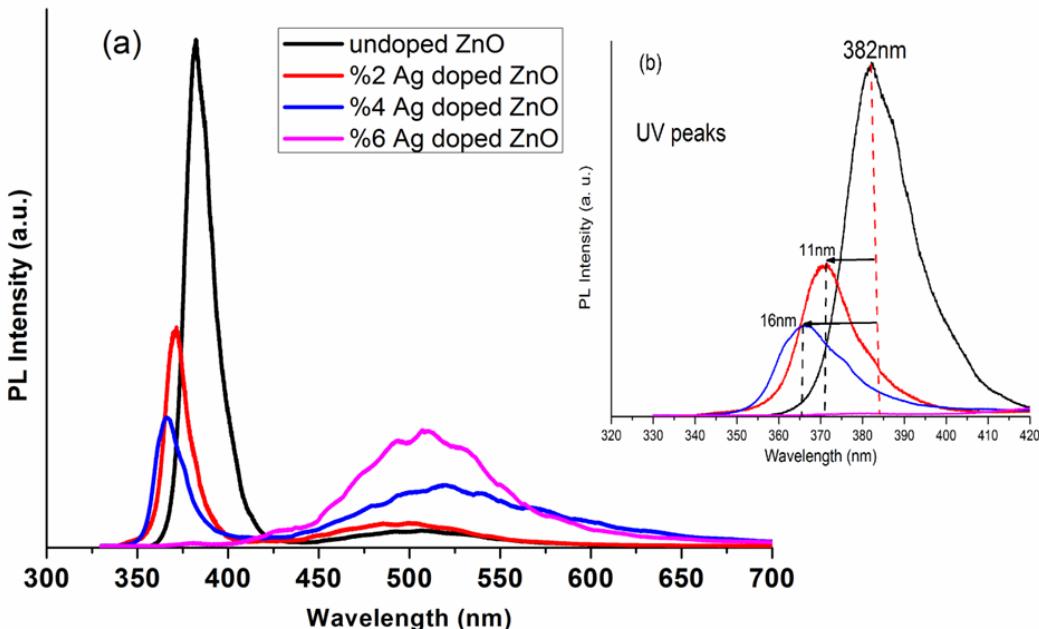


شکل ۴. محاسبه گاف نواری نوری نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ از نقره

۳-۳-۳- بررسی نتایج نورتابناکی:

شکل ۵(a) طیف PL مربوط به نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های مختلف از نقره را نشان می دهد. همه طیف ها قله هایی در محدوده فرابنفش و مرئی دارند. شکل ۵(b)، نشر UV، حدود ۳۸۲ nm برای اکسیدروی خالص و ۳۶۶ و ۳۷۸ nm به ترتیب برای نمونه های ۰.۲٪، ۰.۴٪ و ۰.۶٪ وجود دارد. از آنجایی که نقره به عنوان یک جذب کننده

اکسیژن، سریع تر از روی عمل می کند و اینکه نقره به عنوان یک فاز اضافی در ساختار XRD مشاهده شد، انتظار می رفت که قله ناحیه مرئی طیف PL نانوساختارهای آلاییده شده با نقره افزایش چشمگیری یابد که در طیف های PL این موضوع مشاهده می شود. نشر UV مربوط به اکسیدروی خالص معمولاً مربوط به بازتر کیب تابشی اکسیتون های آزاد است که نشر لبه نواری نزدیک (NBE) نیز نامیده می شود و به نوعی بیانگر میزان گاف نواری نیمرسانان نیز می باشد [۹، ۱۰]. با استفاده از رابطه $E_g = \frac{hc}{\lambda}$ گاف نواری نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های متفاوت از نقره در جدول ۱ آورده شده است.



شکل ۵. (a) طیف PL نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده شده با میزان های مختلف از نقره، (b) نشر UV نمونه های اکسیدروی خالص و آلاییده با میزان های مختلف از نقره

جدول ۱. گاف نواری نمونه های خالص و آلاییده با میزان های متفاوت از نقره

FWHM(nm)	UV/DLE	گاف نواری (eV)	ترکیب
۱۵	۳۲/۶۹	۳/۲۴	ZnO
۱۴	۹/۵۴	۳/۳۴	Zn _{0.98} Ag _{0.02} O
۱۹	۲/۱۰	۳/۳۸	Zn _{0.96} Ag _{0.04} O
۵۰	۰/۰۲	۳/۲۷	Zn _{0.94} Ag _{0.06} O

با توجه به طیف PL می توان گفت نمونه های آلاییده شده در مقایسه با نمونه خالص یک جایجاپی آبی دارند که نشان دهنده پهن تر شدن گاف نواری این نمونه ها نسبت به نمونه خالص می باشد. نتایج بدست آمده با کارهای قبلی توافق خوبی دارد [۹-۱۲]. در طیف PL نوارهای نشر سبز (GE) (۵۰۰-۵۱۹ nm) وجود دارند. نشر سبز مربوط به انتقال الکترون از جای خالی اکسیژن به اکسیژن میان شبکه ای یا انتقال الکترون بین روی میان شبکه ای و اکسیژن میان شبکه ای و یا گذار از نوار هدایت به مکان هایی که اکسیژن بجای روی قرار گرفته است، می باشد [۹]. شدت نشر UV در دمای اتاق مربوط به تغییر غلظت الکترون است، در حالی که شدت نشر مرئی به چگالی نواقص ذاتی در نمونه ها بستگی دارد. بنابراین با توجه به شدت بیشتر نشر

UV، نسبت به شدت نشر مولی در نمونه خالص در مقایسه با نمونه‌های آلایش یافته با نقره، در نمونه خالص غلظت الکترون بیشتر و چگالی کمتر نواقع از نمونه‌های آلاتیده است. نسبت شدت باند $\frac{UV}{DLE}$ یکی از مهم ترین عواملی است که برای بررسی کیفیت نوری نمونه‌ها به کار می‌رود^[۱۰]. طبق نتایجی که برای این نسبت در جدول فوق ارائه شده، مشاهده می‌شود که با افزایش ناخالصی این مقدار کاهش می‌یابد که این موضوع دلالت بر کاهش کیفیت بلورینگی نمونه‌ها دارد. نصف پهنهای قله بیشینه UV (FWHM) نیز می‌تواند معیار دیگری برای برآورد کیفیت محصولات به دست آمده باشد. به طوری که کوچکتر بودن این پارامتر بیانگر کیفیت نوری بالای محصول است^[۱۰]. بر اساس جدول ارائه شده، نانوذرات اکسیدروی خالص از کیفیت نوری بالاتری برخوردار هستند.

۴- نتیجه گیری:

نانوذرات خالص و آلاییده شده با نقره اکسیدروی با درصدهای مختلفی از نقره به روش سل-ژل رشد داده شدند. مشاهدات نتایج TEM نشان داد که، نانوذرات اکسیدروی آلاییده با نقره در این کار دارای اندازه ای کوچکتر از نمونه خالص هستند. نتایج الگوهای پراش XRD نشان دادند که یون نقره توانست در ساختار بلور اکسیدروی نفوذ کند. مطالعات نوری نانوذرات نشان داد که، گاف نواری نانو ساختارهای آلاییده شده با نقره نسبت به نمونه خالص بزرگتر شده است. همچنین این مطالعات نشان دادند که کیفیت نوری نانوذرات اکسیدروی بواسطه وجود نقره کاهش یافته است.

۵- مراجع:

- [1] R. Yousefi, A. K. Zak, F. Jamali-Sheini, *Ceramics International*, **39** (2013) 1371-1377.
- [2] S. Ranjan, K. Ganguly, K. Mishra, T. Mishra, M. Ningthoujam, R. S. Roy, S. K. Pathak, L. C, *Journal of Colloid and Interface Science*, **366** (2012) 8.
- [3] M. He, Y. F. Tian, D. Springer, I. A. Putra, G. Z. Xing, et al, *Appl. Phys. Lett* **99** (2011) 222511.
- [4] Ahmed. A. Ibrahim, G.N. Dar, Shabi. A. Zaidia, A. Umara, M. Abaker, H. Bouzid, S. Baskoutas, *Talanta*, **93** (2012) 257.
- [5] R. Chauhan, A. Kumar, R. Chaudhary, *J Sol-Gel Sci Technol*, **63** (2012) 5463.
- [6] Nguyen Van Nghia, Tran Nam Trung, Nguyen Tu, N. Doan Minh Thuy, *Journal of Synthesis Theory and Applications*, **1** (2012) 18.
- [7] R. Bhargava, P. K. Sharma, A. K. Chawla, S. Kumar, R. Chandra, A. C. Pandey, N. Kumar, *Materials Chemistry and Physics*, **125** (2011) 664.
- [8] C. Ton-Thata, M. Foley, M. R. Phillips, T. Suzuki, Z. Smith, *Journal of Alloys and Compounds*, **522** (2012) 114.
- [9] A. B. Djurisic, Y. H. Leung, *small*, **2**, No. **8-9** (2006) 944.
- [10] R. Yousefi, PhD thesis, Dept of physics, Faculty of Science, University of Malaya, Kuala Lumpur, (2010).
- [11] N. S. Sabri, A. K. Yahya, M. K. Talari, *Journal of Luminescence*, **132** (2012) 1735.
- [12] L. N. Tong, Y. C. Wang, X. M. He, H. B. Han, A. L. Xia, J. L. Hu, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, **324** (2012) 1795.